

科目名（英文表記）	ビジネス法務Ⅱ（知的財産マネジメント） (Business Law Ⅲ)										
科目区分	発展科目	単位数	2単位								
担当教員名	小寺 正史（非常勤講師） 富田 尊彦（非常勤講師） 太田 清子（非常勤講師）	ナンバリング	MBA_E_EL 6321								
研究室番号	なし	連絡先電話番号	011-281-5011								
Eメール・アドレス	m-kodera@kmlaw.jp										
<b>授業の内容及び方法：</b> 次頁以降に記載。											
<b>授業の目的：</b> 知的財産は特許・商標のみならず企業機密の保護を含む広い範囲に及び、企業活動において極めて重要となっています。知財紛争などを扱ってきた弁護士と特許出願等の実務に精通した弁理士により、事業活動に必要な実践的な授業を実施します。 授業は、次の点を習得することを目的とします。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1 知的財産の概要</li> <li>2 特許・ブランド等の知的財産の取得方法の概略</li> <li>3 特許戦略やブランド戦略など事業活動における知的財産の活用戦略</li> <li>4 企業秘密保護・パテントの保護など知的財産保護の方法</li> <li>5 知的財産を巡る紛争についての対処方法</li> </ol> 到達目標は、知的財産に関する基本的な考え方を理解し、事業活動において知的財産に関する問題に遭遇したときに、取りあえず対応が可能な程度の能力を身につけることです。											
<b>使用教材：</b> ・産業財産権標準テキスト（総合版）第5版（発明協会制作） ・202年知的財産権制度入門テキスト（特許庁制作） （特許庁のホームページからダウンロード）											
<b>成績評価の方法：</b> <table border="1" data-bbox="501 1532 1187 1700"> <thead> <tr> <th>評価の対象</th> <th>配分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出席率</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>事前・事後の課題、授業への参加</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>期末レポート</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>評価に不服のある場合には、不服申立書を以て、教務委員長に申し出ること。</p>				評価の対象	配分	出席率	10%	事前・事後の課題、授業への参加	40%	期末レポート	50%
評価の対象	配分										
出席率	10%										
事前・事後の課題、授業への参加	40%										
期末レポート	50%										
<b>履修上の注意事項：</b> 産業財産権標準テキスト（総合版）第5版（発明協会制作）は講義までに購入してください。											